

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 2 区分

【発行日】平成 17 年 9 月 22 日 (2005.9.22)

【公開番号】特開 2004-238304 (P2004-238304A)

【公開日】平成 16 年 8 月 26 日 (2004.8.26)

【年通号数】公開・登録公報 2004-033

【出願番号】特願 2003-27161 (P2003-27161)

【国際特許分類第 7 版】

C 07 D 319/06

G 03 F 7/004

G 03 F 7/039

H 01 L 21/027

【F I】

C 07 D 319/06

G 03 F 7/004 5 0 1

G 03 F 7/039 6 0 1

H 01 L 21/30 5 0 2 R

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 4 月 15 日 (2005.4.15)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

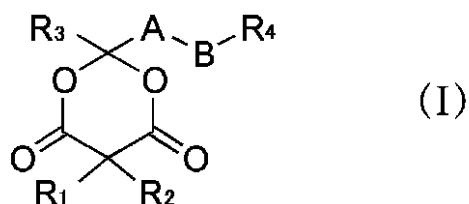
【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

下記一般式 (I) で表される化合物。

【化 1】



一般式 (I) 中、

R_1 及び R_2 は、同じでも異なってもよく、水素原子、アルキル基、シクロアルキル基、アリール基又はアラルキル基を表す。 R_1 と R_2 とは、結合して環を形成してもよい。また、 R_1 と R_2 とは、一緒になって二重結合で環と結合する置換基となってもよい。

R_3 及び R_4 は、同じでも異なってもよく、アルキル基、シクロアルキル基、アリール基又はアラルキル基を表す。

A は、アルキレン基を表す。

B は、ヘテロ原子を表す。

【請求項 2】

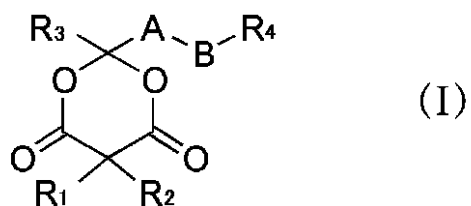
(A) 活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物、

(B) アルカリ現像液に対して不溶性あるいは難溶性であり、酸の作用でアルカリ現像液に可溶性となる樹脂及び

(C) 下記一般式 (I) で表される化合物

を含有することを特徴とするポジ型レジスト組成物。

【化 2】



一般式 (I) 中、

R_1 及び R_2 は、同じでも異なってもよく、水素原子、アルキル基、シクロアルキル基、アリール基又はアラルキル基を表す。 R_1 と R_2 とは、結合して環を形成してもよい。また、 R_1 と R_2 とは、一緒になって二重結合で環と結合する置換基となってもよい。

R_3 及び R_4 は、同じでも異なってもよく、アルキル基、シクロアルキル基、アリール基又はアラルキル基を表す。

A は、アルキレン基を表す。

B は、ヘテロ原子を表す。

【請求項 3】

請求項 2 に記載のポジ型レジスト組成物によりレジスト膜を形成し、当該レジスト膜を露光、現像することを特徴とするパターン形成方法。